

課題: 能動素子の進歩を把握する指標のひとつとして、そのサイズを比べてみよう。
真空管と先端MOSプロセスで、何桁くらい大きさが違うだろうか。
代表的な寸法として、真空管は直径18mm, 高さ40mmのMT管を、また
CMOSは $1\mu\text{m} \times 1\mu\text{m}$ とし、深さ方向は(普段あまり考えないが)ざっくり $0.1\mu\text{m}$ と
してみよう。

質問・コメント・感想・意見等がありましたら、随意追記願います。

提出先: yuji.gendai@gunma-u.ac.jp

提出期限: 2020年11月24日

フォーマット:

subject: [講義レポート] 第6回 学籍番号・氏名(よみがな)

本文: 源代が読める形なら何でも良いが、数行～数十行程度のtext形式での回答を期待している。

図が必要ならファイル添付も可。